

BG-401A 型曝光机

主要用于中小规模集成电路、声表面波器件和其它各种半导体元器件制造工艺中的对准及曝光。

主要技术特点：

※ 对准精度高，漂移小。精密楔形误差补偿机构实现三点找平，找平力小，延长掩模版使用寿命。

※ 采用柱体蝇眼透镜和高能力集光的椭球反射镜等精密光学件，具有较高的光强、均匀性、光学分辨率。

※ 在 X、Y 方面进行大范围扫描观察，可进行单视场或双视场切换，提高对准效率和套准精度，同时兼容 CCD 成像显示功能。

※ 电气控制采用可编程控制器

(PLC)、LCD 显示屏，操作方便，汞灯电源易于触发，可靠性高。该设备的关键件采用进口或专业厂家制造，气动元件采用 SMC 的产品，提高了设备的稳定性、可靠性，同时提供个性化服务。



主要技术指标：

- 工作台行程：
X 向：±5mm Y 向：±5mm
Z 向：3mm θ 向：±12°
- 掩模尺寸：5" × 5"
- 基片尺寸：φ4"
- 基片与掩模微分离间隙：0-0.05mm

- 曝光分辨率：1.5um（真空接触）
- 曝光系统及波长：采用 250W 超高压汞灯，UV400
- 曝光方式：真空接触、硬接触
- 曝光时间：0-999.9s 连续可调
- 曝光面积：φ108mm
- 曝光不均匀性：±3%



分离视场显微镜

总倍率：100×（50×可选）

扫描范围：50mm×50mm

调焦范围：8mm

物镜分离距离：28-90mm

所需设施：

输入电压： ~220V±22 V(50Hz)

整机功率： 1KW

室内光线： 红色、黄色

压缩空气： 0.5~0.7MPa

氮气： 0.2~0.4MPa

真空： -0.08~-0.1MPa

体积及重量：

外形尺寸： 1000mm×700mm×1300mm

重量： 300kg